



**JASDAQ**

平成19年1月26日

各位

会社名 トッキ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 津上健一  
(JASDAQ・コード9813)  
問合せ先 執行役員 経営統括部長 鈴木孝文  
電話 03-5205-2901

**GEグローバル・リサーチセンターと有機ELディスプレイ・有機エレクトロニクス  
製品等製造向け「PE-CVD膜封止技術及び装置」の  
共同開発及び商業活動に関する業務提携のお知らせ**

当社は本日、GE（ゼネラル・エレクトリック社（NY証券取引所;GE））の中央研究所であるGEグローバル・リサーチセンターと、有機ELディスプレイ・有機エレクトロニクス製品等製造向けの「PE-CVD（※1）膜封止技術及び装置」の開発及び販売に向け、共同研究を進めることで合意いたしました。この提携により有機ELディスプレイの将来の製造プロセス革新や市場拡大を促進することが可能となります。

当社は有機ELのリーディングカンパニーとして、ファクトリー・オートメーションシステムを駆使した成膜から封止までを一貫して行う独自の技術等が国内外から高い評価を頂いております。

この共同開発契約において、GEグローバル・リサーチセンターは当社に独自のPE-CVDによる膜封止技術（※2）のライセンス供与を行い、当社はその技術を有機EL製造システムと統合することになっています。有機ELデバイスは大気中の水分や酸素によってデバイス自身が容易に劣化してしまうため、高レベルの封止技術が必要となります。GEグローバル・リサーチセンターが開発した膜封止技術は今後の有機ELデバイス及びその製造技術において極めて重要な要素と考えられています。この共同開発の主要な目的はGEグローバル・リサーチセンターの膜封止技術を組み合わせたパイロットラインを開発し、製造装置を確立するものです。最終的な目標は有機ELディスプレイや有機エレクトロニクス製品を含めた、産業界の様々な分野で使用できるPE-CVD膜封止装置を製造し、それを国内外の市場に販売展開していくことです。

記

1. 基本合意の概要

- (ア) 当社及びGEグローバル・リサーチセンターは、これまでに双方が培ってきた経験、ノウハウを踏まえた装置開発を共同で行います。
- (イ) この装置を開発する過程では、試作実験機を製造し、両社相互の技術者派遣を含めた研究開発・実験・評価を行うことで、装置として商業化できるレベルへ引き上げます。
- (ウ) 共同開発中にGEが保有する膜封止技術及び膜封止に関する特許等は、双方の合意なく当社以外の第三者への提供は行ないません。
- (エ) 商業化できるレベルが確認でき次第、共同で商業活動を開始いたします。

2. 今後の見通し

今後はこの共同研究を積極的に推進し、有機EL技術の発展と当社の製造装置の売上増加を見込んでおります。

なお、装置の開発が完成し販売を行う際には、再度情報開示を行います。

また、今回の提携により今後発生する売上高等に関しましては、当期以降の売上となるため、本日発表いたしました「特別損失の発生及び平成19年6月期業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ」での業績予想から修正はございません。来期以降の売上予想に関しま

しては、装置の開発状況等により変動するため、期末の決算短信発表時に情報開示いたします。

### 3. 日程

平成19年1月26日	取締役会
平成19年1月26日	業務提携契約締結
平成19年1月26日	事業開始日

### 4. GEグローバル・リサーチセンターの概要

- (1) 商号 ゼネラル・エレクトリック社 (GE)
- (2) 主な事業等 インフラストラクチャー、インダストリアル、ヘルスケア等様々な研究活動
- (3) 設立年月日 1900年
- (4) 本店所在地 米国ニューヨーク州ニスカユナ
- (5) 代表者 マーク リトル
- (6) 従業員数 2,500人
- (7) その他概要

GEグローバル・リサーチセンターは、米国で最初の工業研究所であり、世界有数の多様性に富んだ研究開発センターの一つで、GEのすべてのビジネスと連携し、革新的なテクノロジーを供給しています。GEグローバル・リサーチセンターは、100年以上にわたりGEのテクノロジーの中核として、医療画像、発電、航空機エンジン、先進材料や照明などを含む様々な分野における革新技術を開発しています。GEグローバル・リサーチセンターはニューヨーク州ニスカユナに本部をおき、インドのバンガロール、中国の上海、ドイツのミュンヘンにも研究開発拠点を設立しています。

GEグローバル・リサーチセンターの詳細については、[www.research.ge.com](http://www.research.ge.com) をご覧ください。

以上

(ご参考)

#### (※1) PE-CVDとは

PE-CVD (Plasma Enhanced - Chemical Vapor Deposition) とは、原料物質を含むガスを高周波でプラズマ状態にして化学反応を促進させ、基板上に膜として堆積させる方法です。この膜の厚さは約0.1マイクロメートル～2マイクロメートルと非常に薄い膜を作ることができます。

#### (※2) 有機ELの膜封止技術とは

有機ELは、水分や酸素に弱い有機材料を大気雰囲気から遮断するための「封止」が必要です。現在の主な有機ELでは、ガラス板や金属製缶を用いて封止を行いますが、この封止を薄い膜で行うのが「膜封止」です。有機ELの軽量化、薄型化、大型基板化、そして将来的にはフレキシブル化のために必要不可欠な技術であり、有機EL関連での最先端技術です。

